

フォトマスク関連技術の国際会議「SPIE Photomask Technology」に参加

株式会社ニューフレアテクノロジー

2025 年 9 月 26 日

ニューフレアテクノロジー (NFT) は、2025 年 9 月 22 日から 25 日まで米国カリフォルニア州モンレー市で開催された「SPIE Photomask Technology」に参加しました。

本学会は、光学やフォトニクス分野における国際学会である SPIE (The International Society for Optical Engineering, 国際光工学会) が毎年開催しているもので、フォトマスクとパターニング、計測器、測定、材料、検査、修理、マスクビジネス、High-NA EUV リソグラフィーなどに関する国際的技術会議です。

NFT は、本会議には毎年参加しており、今年もマルチ電子ビームマスク描画装置に関する最新の開発状況について 1 件の口頭発表、1 件のポスター発表を行っています。

< SPIE Photomask Technology での NFT の口頭発表／ポスター発表 >

Session

Paper 13687-1

[MBM-4000 multi-beam mask writer enabling mask fabrication for a new era](#)

Author(s): Kenichi Yasui, Jumpei Yasuda, Haruyuki Nomura, Hiroshi Matsumoto, Tomoo Motosugi, Hayato Kimura, Yoshinori Kojima, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Presenter

Kenichi Yasui, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Poster Session

Paper 13687-113

[Electron multibeam mask writer for mature nodes: MBM-2000C](#)

Author(s): Issei Aibara, Masashi Uchiya, Takuma Abe, Hiroshi Matsumoto, Yoshinori Kojima, Masato Saito, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

Presenter: Issei Aibara, NuFlare Technology, Inc. (Japan)

関連リンク:

[Photomask Technology 2025, Conference Details](#)

以上